

ICP-RIE 装置

メーカー・名称	サムコ RIE-101iPH
装置名	イオンビームエッチング装置
料金	8,200円/半日
最大試料サイズ	100 mm径基板
最大RF電力	800 W
最大バイアス電力	150 W
プロセスガス	酸素、アルゴン
エッチング対象	金属膜

概要

本装置は、金属膜等のエッチングが可能です。当研究所には本装置以外にシリコン窒化膜・酸化膜用にRIE装置が、シリコン垂直加工用にシリコンディープエッチング装置があります。

